

# 第16回 日中弁理士交流会報告書

日本弁理士会 国際活動センター

センター長 藤村 元彦

アジア部会長 越川 隆夫

中国の特許事情の現状確認及び今後の進展等の事情を日本弁理士会としても継続的に把握すべきであるとの認識の下、日中弁理士交流会が本年も実施されることになり、去る11月8日に東京にて第16回日中弁理士交流会が行われたので、以下内容を報告します。

## 【日程】 2004年11月8日（月）

9:30～12:20 クローズドミーティング 日本弁理士会会議室

14:00～17:20 オープンセミナー 日本弁理士会会議室

18:00～20:00 歓迎レセプション 霞ヶ関東京會館

【概略】 午前中のクローズドミーティングでは、正副会長会及び関係委員会と中国代表団とで会務の情報・意見交換が行われた。午後は、一般会員に対し、中国側から最近の特許事情が講演された。

## 【クローズドミーティング】

【時間】 9:30～12:20

【出席者】

【日本側】

【正副会長会】 会長 木下 實三  
 総括副会長 佐藤 辰彦  
 副会長 浅賀 一樹  
 副会長 吉田 芳春  
 副会長 福田 賢三  
 副会長 杉本 ゆみ子  
 副会長 吉田 稔  
 副会長 井上 一

【調査室】 調査室長 仁平 孝

【国際活動センター】 センター長 藤村 元彦  
 副委員長 越川 隆夫  
 副委員長 高見 和明  
 委員 橘谷 英俊

【事務局】 事務総長 一場 満

【中国側】

【ACPAA】 会長 Gao Lu Lin (高 蘆麟)  
 副会長 Wu Bing Fen  
 副会長 Li Yong (李 勇)  
 副会長 Li Qiang

副会長 Ding Ying Lie (丁 英烈)

秘書長 Yuan De (袁 徳)

副秘書長 Dong Ma Ling

会員 Cheng Tai Keung

会員 Guo Xia Dong

会員 Lina Xie

会員 Ma Tie Liang

会員 Hao Qing Fen

会員 Ahang Li Yan



両正副会長会と国際活動センター

【内容】両会長の挨拶、メンバー紹介、記念品の交換の後、2004年度の会務報告が日本側は井上一副会長から、中国側は袁秘書長からそれぞれ発表された。そのなかで、高会長からは、2003年度日本から2.4万件の特許出願があったこと、最近日本からの出願が急増していることなどが、また、袁秘書長から ACPAA の対外活動状況などの説明の他、中国の専利代理人事務所560事務所のうち、115事務所が渉外事務所（外国からの仕事を受けることができる事務所）になったこと等の説明があった。その後、発表内容に対する質疑・意見交換がなされた。

### 【オープンセミナー】

【時間】 14:00～17:20

【司会者】 橘谷 英俊 委員

【言語】 日中同時通訳

【挨拶】 日本弁理士会を代表して、日本弁理士会国際活動センターセンター長、藤村元彦が開会の挨拶を行った。日中の友好を図ると共に、PCTその他についての意見の発信を行い、日頃の実務に役立ててほしい旨の挨拶があった。

次いで、中華全国専利代理人協会秘書長、袁徳先生より4人の先生方の講演を通じて、中国での知的財産権の取り扱いを説明していただく旨と、更に頻繁な交流を行いたい旨のご挨拶があった。

なお、一般会員の参加者は約130名程であった。

### 【講義1】 中華全国専利代理人協会会長 高 蘆麟 先生

#### (1) 中国の特許出願の最近の発展

中国国内出願、海外からの特許出願、PCT出願、共にここ数年出願件数が伸びている。

近年は日本の企業に特許付与件数が増えており、米国の約2倍になっている。また、近年では韓国が特許付与件数第3位となっている。

企業別でみると、海外から出願された特許では、2003年度上位10社中に日本企業が7社入っている。

分野別の出願件数は、医学分野が最も多く、デジタルテクノロジー、半導体がそれに続く。

中国での特許付与の伸びは、2002年～2003年にかけては、73%、2003年1月～9月と、2004年1月～9月では、43%になる。

審査員数を倍増し、コンピュータ処理を取り入れることによって、効率化を図った。また、審査部門も5部門から7部門に増やした。

さらに、実体審査機関を従来の56ヵ月から30ヵ月に短縮し、覆審委員会を独立した司法機関として、SIPOの業務強化を図った。

また、電子出願制度を2004年3月から開始した。

特許鑑定 司法機関から公認された鑑定委員会の鑑定を受けることができる。報告書は、裁判官の判決の参考にされる。

中国税関の国境措置 中国では、輸出品についても税関で検閲がある。著作権、商標、特許侵害について、中国は輸入、輸出ともに検閲がある。

#### (2) 中国特許制度の今後の発展方向

均等論 中国でも実施されている。エレメントバイエレメントで比較する。判定日の基準は、侵害日である。

#### (3) ソフトウェアとビジネスモデルについて

中国では、現在のところ、非常に狭い範囲でしかソフトウェア特許は認められていない。また、ビジネスモデルについては適用されない。

ソフトウェアおよびビジネスモデル特許については、SIPOにより検討中である。

### 【講義2】 中華全国専利代理人協会秘書長、袁 徳 先生

中国における特許出願手続き —日本の出願人が注意すべきこと—

について講義して頂いた。

審査プロセスは、日本と基本的に同じである。

中国特許手順には、法的手順と、行政規程がある。



日中合同理事会

特許手順は、キャリア、期限、費用、の3つの基本要素からなる。

日本の代理人が注意すべき点としては、書面の声明の提出、3ヵ月以内に優先権書類を提出する、12ヵ月の優先期間を遵守する、出願日から2ヵ月以内に出願費用と優先権費用を払う、ことなどがある。

新しい生物材料に関する特許を出願する場合は、生物材料のサンプルを国際保管機構に出すこと、保管証明書と生存証明書を国家知的財産局に提出しなければならない。また、ヌクレオチドあるいはアミノ酸の序列に関する内容を含む場合は、序列表を提出しなければならない。

自発補正の時期

実質審査請求時

実質審査通知書への応答時

分割出願のタイミングは補正の時期と同じである。分割命令による場合は、通知書の日から2ヵ月以内である。

翻訳文の処理について

一般的な国家出願では、翻訳文は出願書類として提出される。公開範囲（中国語での）を超えない範囲で訂正が認められる。

PCT出願については、国家交付の準備ができる前、および実質審査通知書を受け取ってから3ヵ月以内であれば訂正することができる。訂正の範囲は原文を超えることができない。

**【講義3】** 中華全国専利代理人協会副会長、李 勇 先生

「中国における特許権の司法的および行政的保護」について講義して頂いた。

中国において特許係争が発生した場合、特許権者は、1) 裁判所に提訴する、2) 特許行政管理機関に処理を求める、という2つの方法を取る事ができる。

1) 裁判所は、最高人民法院、高級人民法院、中級人民法院、基本人民法院の4種類があり、特許紛争は、中級人民法院以上の裁判所で受理される。中国では、2審制がとられている。

2) 行政ルートは、国家知識産権局と、各地方の知識産権局があり、地方の知識産権局が手続きを行う。国家知識産権局は、これをスーパーバイズする役である。

等級管轄：司法管轄では、どのランクの裁判所で1審を争うかが重要である。この決定は、主として訴訟金額が基準となる。

地域管轄：侵害行為が発生した場所の裁判所が管轄権を有する。ただし、製造者と販売者を共同被告として訴える場合は、地元有利に働く恐れがある場合など、権利者が製造者所在地での裁判を望まない場合は、販売地が管轄となる。

提訴前の措置：所定の条件を満たせば、差止請求を行うことができる。

証拠について 挙証が困難な場合は、提訴前の証拠保全が可能。

新たな証拠を後日提出することもできる。

提訴後の証拠保全も可能である。

賠償について：最大50万人民元

訴訟中止について：特許の場合は中止しなくても良い

実用、意匠の場合は、例外を除いて、中止する。

行政保護：早く差し止めたい場合は、行政保護が有効である。その他の場合は司法手続きを取るのが良い。

**【講義4】** 中華全国専利代理人協会副会長、丁 英烈 先生

「中国における特許係争の調停」について講義して頂いた。

行政救済、司法救済は、時間とお金がかかるため、特許紛争の解決には和解が優れていることがある。

和解で解決された特許紛争は70%以上である。

和解には、訴前和解、訴中の当事者間和解、裁判官の職権和解がある。

中国では、特許意識がまだ薄いので、侵害が発生し



合同理事会において会務報告する井上一副会長

やすい。特許紛争が発生した場合には、和解の可能性を優先的に考えなければならない。

【その他】講義の後、下記の質問があり、担当講師から回答を頂いた。

1) PCTの国内移行期限の2ヵ月延長の正当な理由とはどのようなものか？

実質的には自由に延長できる。

2) 外国語出願制度はあるか？

ない

3) 自発補正は可能か

中国に訂正審判制度はない

4) 中国の新規性の判断基準は？

中国は *relative novelty* である。すなわち、公用による新規性の喪失は中国国内のみである。

同じ思想を2者が出願した場合

前者が公開されると、後者は影響を受ける。前者が公開されなかった場合は、後者が特許を受けうる。

5) 中国の進歩性の判断基準は？

突出した実質的特徴（非自明性）が求められる。

顕著な進歩（技術的效果）が求められる。

ただし、両方は求められていない。

6) 中国税関による検閲（テキスト14ページ）

実用新案、意匠も対象となるか

なる。商標も対象となる。

実用新案は無審査であるが、それでも差し止めができるか？

できる。差し押さえられた側の不服申し立ては、後に行いうる。

7) 訴訟における実用新案の検索報告とは？

実用新案の権利者が提出しなければならない。

8) ノウハウは、税関で差し押さえることができるか？

税関に届出をすることはできないし、税関で保護することはできない。証明が困難であるためである。



オープンセミナーにおいて中国の知的財産権制度の改正点を説明する高会長

9) SIPOが作成する検索報告は、特許と実用新案では同じものか？

実用新案では、方法は認められない。

決定権は裁判所にある。

10) 装置クレームにおいて、機能を手段として書いた場合、実用新案の保護対象となるか？

純機能のクレームは対象とならない。

機能を特徴として使うことはできない。

11) 輸出についての検閲について、発明特許品についても検閲されるのか？

される。

当事者が税関に届け出る、あるいは、税関が疑問を持った場合自動的に届け出る。

#### 【歓迎レセプション】

【時間】 18:00～20:00

【場所】 霞ヶ関東京會館

【司会者】 越川 隆夫 部会長

【概略】 正副会長および一般会員（25名）が、高会長をはじめとする中国代表団を熱烈歓迎して、飲食を伴う歓談を行った。